

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2007年11月22日 (22.11.2007)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2007/132757 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2007/059718

(22) 国際出願日: 2007年5月11日 (11.05.2007)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2006-135436 2006年5月15日 (15.05.2006) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社アルバック (ULVAC, INC.) [JP/JP]; 〒2538543 神奈川県茅ヶ崎市萩園2500 Kanagawa (JP).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 曾我部 浩二 (SOGABE, Kouji) [JP/JP]; 〒4101231 静岡県裾野市須山1220-14 株式会社アルバック 富士裾野工場内 Shizuoka (JP). 森本 直樹 (MORIMOTO, Naoki) [JP/JP]; 〒4101231 静岡県裾野市須山1220-14 株式会社アルバック 富士裾野工場内 Shizuoka (JP). 石田 正彦 (ISHIDA, Masahiko) [JP/JP]; 〒4101231 静岡県裾野市須山1220-14 株式会社アルバック 富士裾野工場内 Shizuoka (JP).

(74) 代理人: 阿部 英樹, 外 (ABE, Hideki et al.); 〒1050001 東京都港区虎ノ門1丁目2-18 虎ノ門興業ビル3階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

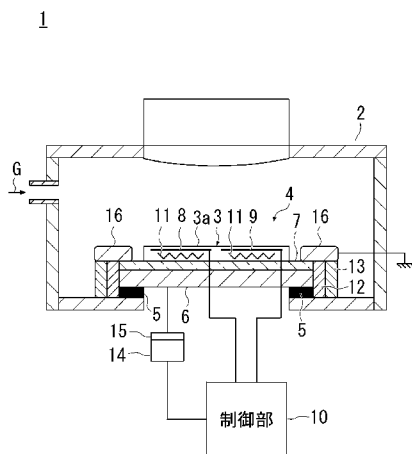
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: CLEANING METHOD AND VACUUM PROCESSING APPARATUS

(54) 発明の名称: クリーニング方法及び真空処理装置



10... CONTROL SECTION

(57) Abstract: A technology of maintaining a fixed attracting force of an attracting surface (3a) of a mechanism for electrostatically attracting a subject to be processed, by cleaning an attracting surface in a vacuum processing apparatus (1). The cleaning method is provided for cleaning the attracting surface (3a) of a hot plate (3) which holds the subject to be treated by electrostatic attraction in a vacuum processing chamber (2). The method is provided with a step of applying high frequency power of 13.56MHz to a metal seat (6) arranged below the hot plate (3) in the vicinity, in a state where a cleaning gas (G) is introduced into the vacuum processing chamber (2), and cleaning the attracting surface (3a) of the hot plate (3).

[続葉有]

WO 2007/132757 A1



(57) 要約:

真空処理装置(1)内において処理対象物を静電吸着する機構の吸着面(3a)をクリーニングしてその吸着力を一定に保持する技術を提供する。本発明方法は、真空処理槽(2)内において処理対象物を静電吸着により保持するホットプレート(3)の吸着面(3a)をクリーニングするクリーニング方法であって、ホットプレート(3)の下方近傍に配置された金属製の台座(6)に対し、真空処理槽(2)内にクリーニング用ガス(G)を導入した状態で13.56MHzの高周波電力を印加することにより、ホットプレート(3)の吸着面(3a)のクリーニングを行う工程を有する。